

اینتل در لیتوگرافی ی فرابنفش کرانه‌ای سرمایه‌گذاری میکند

قرار است اینتل [1] (بزرگترین سازنده ی تراشه ی کامپیوتر در جهان) در پژوهشها ی شرکت لیتوگرافی ی آی‌اس‌ال [2] از هلند سرمایه‌گذاری کند. یک هدف این پژوهشها بارآوردن روشها یی برای کار با ویفرها یی با قطر 450 mm است. فعلن صنایع تولید تراشه با ویفرها یی با قطر 300 mm کار میکنند. هدف دیگر بارآوردن روشها ی لیتوگرافی با فرابنفش کرانه‌ای است. فعلن کوتاهترین طولموج ی که در لیتوگرافی به کار میرود 193 nm است. هدف رسیدن به طولموج 20 nm است [3].

[1] Intel

[2] ASML

[3] <http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/jul/26/intel-invests-in-extreme-ultraviolet-lithography>